2001 级半导体器件物理期末试题 A 卷

(电子科学与工程学院 光电子与微电子系 2004.6.23) 考试时间 150 分钟

- 一. 回答下列问题(20分)
 - 1.P-N 结少子正向注入和反向抽取
 - 2.光生伏特效应
 - 3.JFET 沟道夹断
 - 4.欧姆接触
 - 5.LED 的辐射复合效率
- 二. P^+-N 长二极管受到一光源的均匀照射,所引起的 e-h 对的产生率为 GL,解扩散方程,证明(20分)

(a)
$$\Delta p_n = \left[p_{n0} \left(e^{y'_{v_T}} - 1 \right) - G_L \frac{L_p^2}{D_p} \right] e^{-x'_{L_p}} + G_L \frac{L_p^2}{D_p}, (X > 0)$$

$$\Delta n_p = \left[n_{p0} \left(e^{y'_{v_T}} - 1 \right) - G_L \frac{L_n^2}{D_n} \right] e^{x'_{L_p}} + G_L \frac{L_n^2}{D_n}, (X < 0)$$

(b)短路光电流 L.为

 $I_L=qAG_L(L_n+L_p)$

注: 边界条件取为:
$$\begin{cases} x = 0, p_n = p_{n0}e^{\sqrt[\gamma]{\tau}}, n_p = n_{p0}e^{\sqrt[\gamma]{\tau}} \\ x = \infty, p_n = p_{n0}, x = -\infty, n_p = n_{p0} \end{cases}$$

- 三.对于双极结型晶体管(BJT)(10分)
 - 1.画出电流分量示意图,写出各极电流 IE, IB, Ic 的电流表示式以及三者之间的关系式。
 - 2.写出在 x=-xe, x=-We, x=0, x=xb, x=xc 和 x=∞处少子边界条件。
 - 3. 说明 BJT 的放大作用。
- 四. 画出肖特基势垒钳位晶体管的电路图和集成结构示意图。
- 五. 写出 MOSFET 阈值电压的表示式,说明式中各项所代表的物理意义。
- 六. 若晶体管基区度越时间为

$$\tau_B = \frac{1}{D_n} \int_{0}^{x_B} \frac{1}{N_a} \left[\int_{x}^{x_B} N_a dx \right] dx$$

1. N_a=常数

2.
$$N_a = N_0 e^{-ax/x_b}$$

计算 τ_R (15分)

七. 根据
$$I_n = qAn_p\mu_n\varepsilon + qAD_n\frac{dn_p}{dx}$$
和 $\varepsilon = -\frac{d\psi}{dx}$ 证明:
$$\psi_0 = \psi_n - \psi_p = V_T \ln \frac{N_aN_d}{n_i^2} \qquad (15 \, \%)$$

2001级《半导体器件物理》考试题 B 卷

- 1 绘出在偏压条件下 MOS 结构中对应
 - (a) 载流子积累(3分)
 - (b) 耗尽以及 (3分)
 - (c) 强反型的能带和电荷分布的示意图 (4分)

采用 N 型衬底并忽略表面态和功函数的影响。

(总 10 分)

- 2 在 $p^+ n$ 结二极管中,n 区的宽度 W_n 远小于 \mathbf{L}_p ,用 $I_p \Big|_{x=W_n} = qS\Delta p_n A$ (S 为表面复合速度)作为 n 侧末端的少数载流子电流,并以此为边界条件之一,推导出载流子和电流分布。绘出在 $\mathbf{S} = \mathbf{0}$ 和 $\mathbf{S} = \infty$ 时 n 侧少数载流子的分布形状。 (10 分)
- 3 (a) PN 结的空穴注射效率定义为在 x=0 处的 I_p/I 。

证明此效率可写成
$$\gamma = \frac{I_p}{I} = \frac{1}{1 + \sigma_n L_n / \sigma_n L_n}$$
 (5分)

- - (a) 自建电势 ψ_0 (5分)
 - (b) 夹断电压 V_{p0} 和 V_{p} (5分)
 - (c) 电导 G₀ 以及 (5 分)
 - (d) 在栅极和漏极为零偏压时实际的沟道电导(5分) (总分20分)
- 5 试推导 N 沟道 JFET 的电流与电压关系。它的截止面 $2a \times 2a$,为 P^+ 所包围,器件长度 为 L。(总分 15 分)
- 6 推导出金属-氧化物-半导体场效应晶体管
 - (a) 表面电势(10分)
 - (b) 体电荷以及 (5分)
 - (c) 表面电场的表达式(5分) (总分20分)
- 7 假设 p^+ -n 二极管受到一个光源的均匀照射,所引起的电子-空穴产生速率为 \mathbf{G}_{L} ,解二极管的扩散方程以证明

$$\Delta p_{n} = \left[p_{n0} (e^{\frac{V}{VT}} - 1) - G_{L} \frac{L_{p}^{2}}{D_{p}} \right] e^{-\frac{x}{L_{p}}} + \frac{G_{L} L_{p}^{2}}{D_{p}} \qquad (\text{ id} \% 15 \%)$$

2001 级半导体器件物理期末 A 卷答案

(2004.6.20)

一. (20分)

- 解: 1 (1) [2 分] PN 结在正偏压的作用下,空间电荷区势垒下降,N 区电子扩散进入 P 区,P 区 空穴扩散进入 N 区,成为对方区域中的少数载流子。这种现象称为少子注入。
 - (2) [2 分] PN 结在反偏压作用下,空间电荷区势垒升高。飘移运动占优势,N区少子空穴在外场作用下飘移进入 P区,同样 P区电子在外场作用下飘移进入 N区,这种现象叫做少子抽取。
 - 2 [4分] PN 结吸收光子产生电子-空穴对,在空间电荷区作用下,空穴积累在 P侧,电子积累在 N侧,形成电势差——光生电动势。这种效应成为光生伏打效应。
 - 3 [4分] 当增加 JFET 的栅电压或漏时,会使上下两个 PN 结的空间电荷区连通,载流子被耗尽,这种现象称为沟道夹断。
 - 4 [4分] 欧姆接触定义为这样的一种接触,它不会引入较大的寄生电阻,也不是以改变半导体内的平衡载流子浓度。
 - 5 [4分] 辐射复合的电子数占复合的电子数的百分比。

二 [20分]

证明: a. N 区空穴 扩散方程

$$D_{p} \frac{d^{2} p_{n}}{dx^{2}} - \frac{p_{n} - p_{n0}}{\tau_{p}} + G_{L} = 0$$

通解:
$$\Delta p_n = p_n - p_{n0} = Ae^{-\frac{y}{L_p}} + Be^{\frac{y}{L_p}} + G_L \tau_n$$

边界条件
$$x = 0, p_n - p_{n0} = p_{n0} \left(e^{\frac{y}{v_T}} - 1 \right)$$

 $x = \infty, p_n - p_{n0} = G_T \tau_n$

代入通解:
$$\Delta p_n = \left[p_{n0} \left(e^{\frac{v}{v_T}} - 1 \right) - G_L \frac{L_p^2}{D_p} \right] e^{-\frac{v}{L_p}} + \frac{G_L L_p^2}{D_p}$$
 类似地得到 $\Delta n_p = \left[n_{p0} \left(e^{\frac{v}{v_T}} - 1 \right) - G_L \frac{L_n^2}{D_n} \right] e^{\frac{v}{L_n}} + \frac{G_L L_n^2}{D_n}$ (x<0)------ (5分)

b.
$$(5 / T)$$
 $I_p(x) = -qAD_p \frac{dp_n}{dx} = \frac{qAD_p}{L_p} \left[p_{n0} \left(e^{\frac{y}{y_T}} - 1 \right) - G_L \frac{L_p^2}{\tau_p} \right] e^{-\frac{x}{L_p}}$

$$I_{n}\left(x\right) = qAD_{n}\frac{dn_{p}}{dx} = \frac{qAD_{n}}{L_{n}}\left[n_{p0}\left(e^{\frac{v}{v_{T}}} - 1\right) - G_{L}\frac{L_{n}^{2}}{\tau_{n}}\right]e^{\frac{v}{L_{n}}}$$

总电流: (5分)

$$I = I_{P}(0) + I_{n}(0) = qA\left(\frac{D_{P}P_{n0}}{L_{p}} + \frac{D_{n}n_{p0}}{L_{n}}\right)\left(e^{\frac{v}{v_{T}}} - 1\right) - qAG_{L}(L_{p} + L_{n}) = I_{0}\left(e^{\frac{v}{v_{T}}} - 1\right) - I_{L}(0) + I_{L$$

可见光电流为 $I_L = qAG_L(L_p + L_n)$

三. (10分)

1. 电流分量示意图 (3分)



其中虚线为电子流方向,实线为空穴流方向。 \mathbf{p}_{I_c,I_b,I_c} 流入晶体管为正

 I_{co} 包含集电极电子电流 I_{uco} ,空穴电流 I_{pco} 和产生电流 I_G

$$\begin{split} -I_{E} &= I_{nE} + I_{pE} + I_{rg} \\ I_{B} &= I_{pE} + I_{rg} + \left(I_{nE} - I_{nc}\right) - I_{co} \\ I_{c} &= I_{nc} + I_{co} \\ I_{E} + I_{B} + I_{c} &= 0 \end{split}$$

2. 少子边界条件(4分)



$$x = -x_E : p_{nE} = p_{nE0}$$

$$x = -w_{E:}p_{nE} = p_{nE0}e^{v_E/v_T}$$

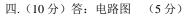
$$x = 0 : n_p = n_{p0}e^{v_E/v_T}$$

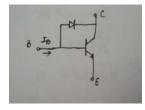
$$x = x_{B:}n_p = n_{p0}e^{v_e/v_T}$$

$$x = x_c : p_{nc} = p_{nc0}e^{v_e/v_T}$$

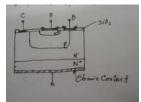
$$x = \infty : p_{nc} = p_{nc0}$$

3. (3分) 答: BJT EB 结正偏,电子由发射区注入到 P 区 (基区),在基区电子以扩散方式运动。一部分电子在基区复合,一部分到集电结。如果基区宽度 x_b \Box L_n ,则大部分电子来到集电结,集电结反偏,在反偏结空间电荷区电场作用大,电子被扫入集电区,结果在集电结形成较大电流。正偏压发射结使反偏压集电结出现大电流,这就是 BJT 的放大作用。





集成结构示意图 (5分)



五.解:
$$v_{TH} = v_{FB} + \varphi_{si} + \frac{-Q_B}{C_0} = \phi_{ms} + \varphi_{si} - \frac{Q_0}{C_0} - \frac{Q_B}{C_0}$$
 (5分)

其中: $-\frac{Q_{s}}{C_{0}}$: 形成强反型时,支撑半导体的体电荷 Q_{B} 所需的电压。

 $\pmb{\psi}_{si}$: 形成强反型时,使半导体表面能带弯曲到强反型状态所需的电压。

 ϕ_{ms} :克服功函数差引起的能带弯曲所需的电压。

 $-\frac{Q_0}{C_0}$:克服 SiO_2 的电荷引起的。

 V_{TH} 阈值电压: 使 MOSFET 开启所需的最小栅偏压。

六.[15 分]

解:
$$\tau_B = \int_0^{x_B} \frac{dx}{v(x)} = \int_0^{x_B} \frac{n_p(x) qA}{I_n} dx$$

$$n_p(x) = \frac{I_n}{qAD_nN_a} \int_x^{x_B} N_a(x) dx$$

$$\tau_B = \frac{1}{D_n} \int_0^{x_B} \left(\frac{1}{N_a} \int_x^{x_B} N_a dx \right) dx$$

a).
$$N_a = C$$

$$\tau_B = \frac{x_B^2}{2D}$$

b).
$$N_a = N_0 e^{-ax/x_B}$$

$$\tau_B = \frac{x_B^2}{aD_n} \left[1 - \frac{1}{a} (1 - e^{-a}) \right]$$

七.[15分]

解:
$$I_n = qAn_p\mu_n\varepsilon + qAD_n\frac{dn_p}{dx}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\psi}{dx},$$

热平衡
$$I_n = 0$$
 : $\frac{d\psi}{dx} = \frac{D_n}{\mu_n} \frac{1}{n_p} \frac{dn_p}{dx}$

$$\frac{D_n}{\mu_n} = v_{T,}$$

$$d\psi = v_T \frac{1}{n_p} \frac{dn_p}{dx}$$

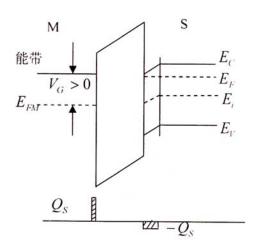
$$\begin{split} \mathcal{X}_p & \square \ \mathcal{X}_n \overset{\text{PL}}{\Longrightarrow} : \quad \psi_0 = V_T \int_{+x_p(-x_p)}^{n_p(x_n)} \frac{1}{n_p} dn_p = V_T \ln \frac{n_p\left(x_n\right)}{n_p\left(-x_p\right)} = V_T \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} \\ & \therefore \psi_0 = V_T \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2} \end{split}$$

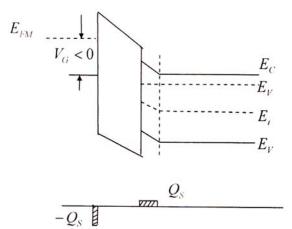
2001级《半导体器件物理》考试题 B 卷 答案

1 解: N型衬底

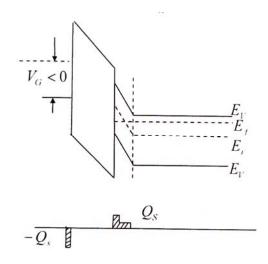
(1) 载流子积累 $(V_G > 0)$

(2) 载流子耗尽 ($V_G < 0$)





(3) 载流子强反型 ($V_G \square 0$)



2 解:连续方程

$$D_{p} \frac{d^{2} \Delta p_{n}}{dx^{2}} - \frac{\Delta p_{n}}{\tau_{p}} = 0 \Rightarrow \Delta p_{n} = k_{1} e^{-x/L_{p}} + k_{2} e^{x/L_{p}} \qquad (1 \%)$$

其中,
$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

由边界条件 $p_n(0) = p_{n0} e^{V/V_T}$, $I_p \Big|_{x=W_n} = qS\Delta p_n A$ ················ (1 分)

得到如下两式:

$$\begin{split} I_p = -qA\frac{dp_n}{dx}D_p = qS\Delta p_nA \Rightarrow S\Delta p_n = -D_p qA\frac{dp_n}{dx}\Big|_{x=W_n} & \cdots \cdots (1 \ \text{分}) \\ & \text{由上述条件可得} \end{split}$$

$$\begin{cases} k_{1} = \frac{\left(S + \frac{D_{p}}{L_{p}}\right)e^{W_{n}/L_{p}}}{\left(S + \frac{D_{p}}{L_{p}}\right)e^{W_{n}/L_{p}} - \left(S - \frac{D_{p}}{L_{p}}\right)e^{-W_{n}/L_{p}}} p_{n0}\left(e^{V/V_{T}} - 1\right) \\ k_{2} = \frac{\left(S - \frac{D_{p}}{L_{p}}\right)e^{-W_{n}/L_{p}}}{\left(S - \frac{D_{p}}{L_{p}}\right)e^{-W_{n}/L_{p}}} p_{n0}\left(e^{V/V_{T}} - 1\right) \\ \left(S - \frac{D_{p}}{L_{p}}\right)e^{-W_{n}/L_{p}} - \left(S + \frac{D_{p}}{L_{p}}\right)e^{W_{n}/L_{p}} \end{cases}$$

所以

$$\Delta p_{n} = p_{n0} \left(e^{V/V_{T}} - 1 \right) \frac{S * sh \left(\frac{W_{n} - x}{L_{p}} \right) + \frac{D_{p}}{L_{p}} ch \left(\frac{W_{n} - x}{L_{p}} \right)}{S * sh \left(\frac{W_{n}}{L_{p}} \right) + \frac{D_{p}}{L_{p}} ch \left(\frac{W_{n}}{L_{p}} \right)} \dots (2 \%)$$

$$\begin{split} I_{p} &= -qAD_{p} \frac{d\Delta p_{n}}{dx} \Longrightarrow \\ S &= 0 \qquad \Delta p_{n} = p_{n0} \left(e^{V/V_{T}} - 1 \right) ch \frac{W_{n} - x}{L_{p}} \\ S &= \infty \qquad \Delta p_{n} = p_{n0} \left(e^{V/V_{T}} - 1 \right) \frac{L_{p}}{W_{n}} sh \frac{W_{n} - x}{L_{p}} \end{split} \tag{2.77}$$

3 (a) 证明:

$$I_{p}(x_{n}) = \frac{qAD_{p}p_{n0}}{L_{p}} \left(e^{\frac{V}{V_{T}}} - 1\right) \qquad (1 \%)$$

$$I = \left(\frac{qAD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{qAD_p p_{n0}}{L_p}\right) \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right) \qquad \cdots \qquad (1 \ \%)$$

$$\gamma = \frac{I_p}{I} = \frac{1}{1 + \mu_n n_{n0} L_n / \mu_n n_{n0} L_n}$$
(1 分)

所以
$$\gamma = \frac{I_p}{I} = \frac{1}{1 + \sigma_n L_n / \sigma_n L_n}$$
 (1分)

(b)
$$\gamma \rightarrow 1$$

因为
$$L_p = \sqrt{D_p au_p} = \sqrt{\mu_p V_T au_p}$$
, $L_n = \sqrt{D_n au_n} = \sqrt{\mu_n V_T au_n}$

$$\overrightarrow{\text{m}} \sigma_n = n_{p0} \mu_n q, \sigma_p = p_{n0} \mu_p q, \tau_n \approx \tau_p$$

所以
$$n_{p0}\mu_n q \sqrt{\mu_p V_T \tau_p} \square p_{n0}\mu_p q \sqrt{\mu_n V_T \tau_n}$$
 … (1分)

又因为
$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{p_{p0}}, p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}}$$

所以 p_{p0} \square n_{n0} 即受主杂质浓度远大于施主杂质浓度。 · · · · · · · (1分)

4 解:

(a)

$$\psi_0 = V_T \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}$$

$$= 0.026 \ln \frac{10^{18} \times 10^{15}}{2.25 \times 10^{20}}$$

$$= 0.76(V)$$
(5 分)

(b)

$$V_{p0} = \frac{qN_d a^2}{2k\varepsilon_0}$$

$$= \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{15} \times (2 \times 10^{-4})^2}{2 \times 12 \times 8.85 \times 10^{-14}}$$

$$= 3.01(V)$$
(3 分)

$$V_p = V_{p0} - \psi_0 = 2.25(V)$$
 (2 $\%$)

(c)

$$G = \frac{2q(a-W)Zu_{n}N_{d}}{L} \qquad (2 fr)$$

$$W = \left[\frac{2k\varepsilon_{0}(V + \psi_{0} - V_{G})}{qN_{d}}\right]^{1/2} = \left[\frac{2k\varepsilon_{0}\psi_{0}}{qN_{d}}\right]^{1/2} = \left[\frac{2\times11.9\times8.85\times10^{-14}\times0.76}{1.6\times10^{-19}\times10^{5}}\right]^{1/2}$$

$$= 1.1\times10^{-4}(cm) \qquad (2 fr)$$

$$\therefore G = 4.75\times10^{-3}\Omega^{-1} \qquad (1 fr)$$

$$\Rightarrow I_{D} = -qu_{n}nA\varepsilon \qquad (3 fr)$$

$$= -4qu_{n}(a-W)^{2}\frac{dV}{dx} \qquad (3 fr)$$

$$\Rightarrow \int_{0}^{L}I_{D}dx = 4qu_{n}N_{d}\int_{0}^{V_{0}}(a-W)^{2}dV \qquad (4 fr)$$

$$\Rightarrow I_{D} = \frac{4qu_{n}N_{d}}{L}\int_{0}^{V_{0}}(a^{2} - 2a\left[\frac{2k\varepsilon_{0}(V + \psi_{0} - V_{G})}{qN_{d}}\right]^{1/2} + \frac{2k\varepsilon_{0}(V + \psi_{0} - V_{G})}{qN_{d}}dV\right]$$

$$\Rightarrow \frac{4qu_{n}N_{d}}{L}\left[(a^{2}V_{d} - \frac{4}{3}a\sqrt{\frac{2k\varepsilon_{0}}{qN_{d}}}(V + \psi_{0} - V_{G})^{3/2} + \frac{4}{3}a\sqrt{\frac{2k\varepsilon_{0}}{qN_{d}}}(\psi_{0} - V_{G})^{3/2}\right]$$

$$+ \frac{4qu_{n}N_{d}}{L}\left[\frac{k\varepsilon_{0}}{qN_{d}}(V_{D} + \psi_{0} - V_{G})^{2} - \frac{k\varepsilon_{0}}{qN_{d}}(\psi_{0} - V_{G})^{2}\right]$$

$$= \frac{k\varepsilon_{p} - \varepsilon_{p}}{L} = n_{p}e^{\frac{k}{M_{p}}} = n_{p}e^{\frac{k}{N_{p}}} = n_{p}e^{\frac{k}{N_{p}}}$$

强反型时: $n_s = p_0$

则
$$\psi_{si} = 2\varphi_f = 2V_T \ln \frac{N_a}{n_i}$$
 (1分)

$$2) \quad x_{dm} = \sqrt{\frac{2k_s \varepsilon_0 \psi_{si}}{q N_a}}$$

$$\therefore Q_B = -qN_a x_{dm} = \sqrt{4qk_s \varepsilon_0 N_a V_T \ln \frac{N_a}{n_i}} \quad \dots \qquad (5 \, \%)$$

3)

由柏松方程:
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{qN_a}{k_s\varepsilon_0}$$

由
$$x$$
 到 x_{dm} 积分, 边界条件 $\frac{d\psi}{dx} = 0$ $x = x_{dm}$, 可得

$$\frac{d\psi}{dx} = \frac{qN_a}{k_s \varepsilon_0} (x - x_{dm}) \tag{2 }$$

$$E = -\frac{d\psi(x)}{dx} = -\frac{qN_a}{k_s \varepsilon_0} (x - x_{dm}) \qquad (2 \ \%)$$

表面电场: x=0

$$E_{m} = \frac{qN_{a}}{k_{s}\varepsilon_{0}} \sqrt{\frac{2k_{s}\varepsilon_{0}\psi_{si}}{qN_{a}}} = \left(\frac{4qN_{a}V_{T}\ln\frac{N_{a}}{n_{i}}}{k_{s}\varepsilon_{0}}\right)^{1/2} \qquad (1 \%)$$

V 加到 PN 结上,

当
$$x > 0$$
时

$$D_{p} \frac{d^{2} p_{n}}{dx^{2}} - \frac{p_{n} - p_{n0}}{\tau_{n}} + G_{L} = 0 \qquad \dots (2 \%)$$

$$\therefore \frac{d^{2}(p_{n} - p_{n0} - G_{L}\tau_{p})}{dx^{2}} = \frac{p_{n} - p_{n0} - G_{L}\tau_{p}}{L_{p}^{2}} \qquad (2 \%)$$

$$x' \xrightarrow{\begin{array}{c|c} P & & N \\ \hline -x_p & x_n \\ \hline & 0 \end{array}} x$$

其中,
$$L_p^2 = D_p \tau_p$$

由边界条件,
$$\begin{cases} x = 0, & p_n = p_{n0}e^{\frac{V}{V_T}} \\ x = \infty, & \Delta p_n = G_L \tau_p \end{cases}$$
(3分)

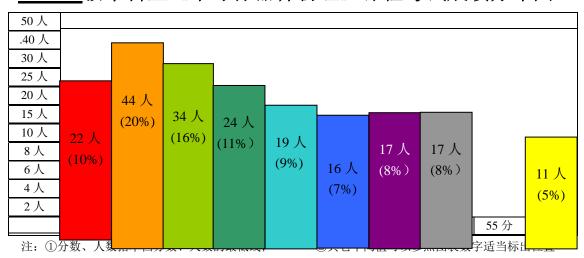
代入到(*)式中,得

$$\begin{cases} K_1 = p_{n0}(e^{\frac{V}{V_T}} - 1) - G_L \tau_p \\ K_2 = 0 \end{cases}$$
 (2 \(\frac{1}{2}\)

$$\therefore \Delta p_n = p_n - p_{n0} = \left[p_{n0} (e^{\frac{V}{V_T}} - 1) - G_L \frac{L_p^2}{D_p} \right] e^{-\frac{x}{L_p}} + G_L \frac{L_p^2}{D_p}$$

吉林大学试卷分析报告

2001 级本科生《半导体器件物理》课程考试成绩分布图



2001 级本科生《半导体器件物理》课程学习状况分析

学生对所学知识的掌握情况,考核中反映出的学生能力和素质状况,考核中发现学生学习中存在的主要问题,加强该课程教学的想法等(本页不足可另附纸)

本次考试成绩分布: 优秀率 30%, 良好率 27%, 及格及中等占大 多数, 考核情况正常。

考核中发现大部分学生基本理论掌握扎实,分析问题和解决问题的能力有所提高,很好地掌握了所学知识,达到了预期的教学效果。在解决实际问题的能力方面,部分同学有所欠缺。比如考试题中四(C)小题,是个实际设计的试题,部分同学反映出没有设计思想,也有部分同学有思想但未能画出器件结构示意图。试题六是平时作业和习题课中均未出现过的题目,是电路分析和参数设计的综合题,大部分同学完成得很好,反映了综合能力较强。有些同学的计算能力也需要提高。

评卷教师签字: 孟庆巨 2004 年 7 月 4 日